●●● 小特集 ビーム物理の世界~近くて遠い隣の分野~

5. エネルギー回収型リニアック(ERL)におけるビーム物理

羽島良一 日本原子力研究開発機構 (原稿受付:2010年4月2日)

エネルギー回収型リニアック(ERL)は、蓄積リング光源を上回る高輝度X線が得られる次世代放射光源と して期待されている.本章では、ERLにおいて高品質かつ大電流の電子ビームを実現するために考慮すべきビー ム物理上の諸問題について概説する.

Keywords:

energy-recovery linac, high-brilliance X-ray, small emittance, beam breakup

5.1 ERL 型次世代放射光源

放射光輝度とビームエミッタンス

蓄積リングを用いて発生するシンクロトロン放射光(ア ンジュレータ放射光)は、エネルギー可変かつ指向性に優 れた X 線であり、物質科学、生命科学を中心に先端科学に 欠かせないツールとして広く利用されている.国内では、 SPring-8、Photon Factory がその代表である.これらの X 線放射光の利用では、分光器で単色化した X 線を集光ミ ラーで試料の微小な領域に照射し、X 線散乱、X 線回折、X 線吸収、蛍光 X 線、光電子発生などを測定する.タンパク 結晶からの X線回折像を測定すればタンパク分子の構造を 決定することができ、高温超伝導体の研究では X 線非弾性 散乱を使って電子軌道の情報を得ている.

このような X 線利用を精密かつ高速に行うためには, 明 るい X 線を小さい領域に集光することが求められる.した がって, X 線光源の性能を表す指標として「輝度」が用い られる.輝度は, X線のエネルギーバンド幅0.1%あたり毎 秒発生する光子数を立体角と光源サイズで割った値として

輝度 =
$$\frac{\text{photons}}{\text{sec}(\text{mm})^2(\text{mrad})^2(0.1\%\text{ bandwidth})}$$
 (1)

と定義される.これまでのX線放射光源の開発は,輝度の 向上(高輝度化)の歴史であった.現在,SPring-8を含む 第3世代放射光源は,最も輝度の高いX線を発生できる放 射光源である.

図1は、アンジュレータによる放射光の発生を示したも のである.高エネルギーの電子が偏向(加速)を受けて放 射する光は、電子の相対論因子(*γ* = *E*/*mc*²)の逆数1/*γ*に等 しい発散角で前方に集中し、ビーム状に発生する.この放 射光を遠方で観測すると、蛇行の周期で決まる振動数に ピークを持つ狭帯域の光が得られる.放射光の波長は、電 子の相対論因子*γ*、アンジュレータ周期長*λu*、アンジュレー

5. Beam Physics Issues in Energy-Recovery Linacs HAJIMA Ryoichi

タの無次元ポテンシャル *a* で決まり, $\lambda = \lambda_u (1+a^2)/(2\gamma^2)$ となる. 一般的なアンジュレータ ($\lambda_u = 2-5$ cm, $a \sim 1$)を仮定すれば, 10 keV 領域 (波長 0.1 nm 帯)の硬 X 線を得るのに必要な電子エネルギーは, 5-8 GeV となる.

ところで、光ビームの広がりの大きさは、光子の位置と 運動量の不確定性原理から $\sigma_0 \sigma'_0 \ge \lambda/(4\pi)$ と表わされる.こ こで σ_0 , σ'_0 は、それぞれ、光の横方向の強度分布と発散角 度分布のrms値である。上式で等号が成り立ち、光の広が りが最小となるのは、光が単一横モードとなる時である。 実際のアンジュレータ放射光では、光自身が持つ広がりに 加えて、電子の横方向広がり(位置と運動量のばらつき) の効果を考慮しなければならない。電子の横方向広がりは エミッタンスと呼ばれる量で定義される。電子の横方向座 標をxとし、横方向の運動量を発散角 $x' = p_x/p_z$ で表すと、 図2に示すように、エミッタンスは、横方向の位置と運動 量の位相空間で電子が占める面積を π で割った値 $\epsilon = A/\pi$ として定義される。エミッタンスが小さいビームほど、細 く発散が小さいビームである。



図1 アンジュレータ放射光の発生.電子ビームは、周期的に交代する磁場中で蛇行運動を行い、蛇行毎に放射光を発生する.その結果、蛇行の周期で決まる振動数にピークを持つ 狭帯域のX線が得られる.

author's e-mail: hajima.ryoichi@jaea.go.jp



図2 電子ビームエミッタンスの定義.電子の横方向位相空間 (位置と発散角)において,電子が占める面積をπで割った 値をエミッタンスと定義する.

SPring-8 では、水平面と垂直面のエミッタンスは、それ ぞれ、3 nm-rad、3 pm-rad 程度である.水平面のエミッタ ンスが大きいのは、電子が放射光を発生する時に受ける反 兆作用(量子的励起)によるものである.3 nm-rad のエ ミッタンスは、蓄積リングとしては最小クラスであるが、 それでも、エネルギー 10 keV(波長 0.12 nm)のX線の固 有の広がりが $\lambda/(4\pi)=10$ pm-rad であるのに比べるとはる かに大きな値である.

近年,X線の利用研究が高度化するにつれて,X線の空間コヒーレンスを使った実験が始まっている.X線回折顕 微法は,コヒーレントX線を物体に照射した時に得られる X線の回折像から物体の構造を求める手法である.従来の X線構造解析では,結晶試料の回折像から構造を求めてい たが,X線回折顕微法では,オーバーサンプリング法と呼 ばれる手法を用いて,コヒーレントX線による試料の回折 像から原子構造を求めるものであり,結晶でない試料につ いてもその構造を解析できる.SPring-8では,これまでに 大腸菌やヒト染色体を対象にしたX線回折顕微法の実験が 行われている.光源の性能が上がれば,さらに小さな試料, 究極的にはタンパクの1分子の観察まで可能になると期待 されている.

X線の輝度を高め、空間コヒーレンスを高めるには、二 つの方法がある.ひとつは、可視光や赤外光で実現してい るレーザーをX線領域に拡張するものであり、このための X線自由電子レーザー(XFEL)が日米欧の3箇所で建設 されている.もうひとつの方法は、電子ビームのエミッタ ンスを小さくして、アンジュレータ放射光の空間広がりを 単一横モードに近づける方法であり、本章の主題であるエ ネルギー回収型リニアック(Energy-Recovery Linac; ERL) は、このための装置である.XFELがピーク出力の高いX 線を低い繰り返し(10-100 Hz)で生成するのに対して、 ERLは従来のX線放射光源と同様の高い繰り返し(0.1-1 GHz)で高輝度のX線を発生できる.

従来光源を超える高輝度 X 線 (高コヒーレンス X 線) を 発生するには、電子ビームのエミッタンスをどこまで小さ くすればよいだろうか.ひとつの目安として、回折限界エ ミッタンスが定義できる.回折限界エミッタンスは、電子 ビームのエミッタンスが光の固有広がりに等しくなる条件 として与えられ、10 keV の X 線に対しては $\varepsilon = \lambda/(4\pi) =$ 10 pm-rad である.厳密な計算によると、回折限界エミッ タンスの電子ビームから発生する X 線の空間コヒーレンス は 25 % である (25 % の光子が単一横モードに含まれる). 回折限界エミッタンスの電子ビームを生成し,この電子 ビームから放射光を取り出せば,放射光の空間的な広がり は光の固有広がりに近づく.すなわち,放射光の空間コ ヒーレンスが向上する.回折限界エミッタンスは,既存の 第3世代放射光源の水平面エミッタンスよりも2桁以上小 さな値である.このような小さなエミッタンスの電子ビー ムを作り出し,放射光源として利用すべく提案されている のが,エネルギー回収型リニアックに基づく次世代放射光 源である.なお,式(1)からわかるように,X線のフラッ クスを一定とした時,輝度の増大とコヒーレンスの増大は 等価であり,次世代放射光源は従来光源に比べて,輝度と コヒーレンスを向上した装置であると言うことができる.

5.1.1 エネルギー回収型リニアック(ERL)の原理と特徴

ERL は高輝度の(エミッタンスの小さい)電子ビームを 大電流で連続的に加速できる装置であり、2000年ごろまで に高出力自由電子レーザー用に開発された[1,2]が、その 後に X 線放射光源への利用が提案された[3]. ERL の原理 を図3に示す.電子入射器で発生した10MeVの電子ビー ムは合流部を経て主加速器(超伝導リニアック)で5GeV まで加速され、周回部へ導かれる. 電子は放射光の発生に よりエネルギーの一部(約0.1%)を失うが、大部分のエネ ルギーは残っている.この使い終わった電子を、減速位相 でリニアックに再入射し, 電子のエネルギーを高周波エネ ルギーとして回収すれば、このエネルギーを後続電子の加 速に再利用することができる. これがエネルギー回収の原 理である.減速後の電子は、入射とほぼ等しいエネルギー でビームダンプへ捨てられる. このようなエネルギー回収 を動作させるには、CW 運転が可能な超伝導空洞を用いる 必要がある.

従来光源の蓄積リングでは同一の電子が多数周回し,放 射光発生で失われたエネルギーはリング内に設置された高 周波加速空洞で補填される.これに対して,ERLでは,電 子のエネルギーは再利用されるが,電子ビームは使い捨て られ,常に新しい電子が入射器から供給される点で蓄積リ ングとは異なる.ERLでは放射光発生による電子ビームエ



図3 エネルギー回収型リニアックに基づく放射光源の原理.入 射器で発生した電子を超伝導リニアックで加速し、放射光 発生に利用する.使い終った電子は、リニアックで減速さ れビームダンプへ捨てられる.リニアックでは、加速ビーム、減速ビームのエネルギー収支がつりあい、外部からの 高周波電力の投入を増やさずに大電流電子ビームの加速が 可能になる. ミッタンスの増大を起こさずに、大電流を加速できるため、放射光の高輝度化、コヒーレンス向上が可能になるのである.

リニアックにおける加速では、電子の進行方向の運動量 が増え、横方向の運動量は増えない.したがって、加速で エネルギーを増すにつれて電子の発散は小さくなり、エ ミッタンスも小さくなる.この現象は電子の横方向運動の 位相空間における断熱収縮と言える. このような現象があ るために、リニアックでは規格化エミッタンス $\epsilon_n = \gamma \beta \epsilon$ を定義し、これを電子ビーム品質の指標とする. 規格化工 ミッタンスは線形加速の前後で保存される量である.X線 放射光の発生のために5GeVまで加速した時に、10keV X線の回折限界エミッタンスを得るには、0.1 um-radの規 格化エミッタンスが必要条件となる。このような小さなエ ミッタンスの電子ビームが、近年進展の著しい、高輝度電 子源(光陰極を備えた電子銃)で発生可能となりつつある. 低エミッタンス電子源を ERL に組み込めば,回折限界エ ミッタンスの電子ビームから高輝度(高コヒーレンス)の X線を発生することができる.これが、ERL 放射光源の特 長である.ちなみに, 陰極表面の半径0.5 mmのスポットか ら電子を引き出す場合に、0.1 µm-radの規格化エミッタン スは電子の横方向温度 kT = 80 meV に相当する.

5.2 ERL 入射器におけるエミッタンス増大とそ の補償

前節で述べたように、ERL 型放射光源では電子の多数周 回に伴うエミッタンスの増大がなく放射光輝度は入射器の 性能で決定されるので,入射器はERL放射光源の重要な要 素である.ERL入射器は電子銃,バンチャー,前段加速器, 合流部などで構成され,横方向収束のためのソレノイド磁 石,四極磁石が含まれる.理想的な線形加速では規格化エ ミッタンスが保存するが,低エネルギーの入射器では,規 格化エミッタンスの増大をもたらす現象が存在する.入射 部におけるエミッタンス増大の原因としては,(1)横方向の 空間電荷力,(2)縦方向の空間電荷力,(3)加速空洞の高周波 場などがある.ここでは横方向空間電荷力,縦方向空間電 荷力によるエミッタンス増大とその補償方法について述べ る.

5.2.1 横方向の空間電荷力

電子バンチの断面において電子が均一な円形の分布を持 っとき,自己電場による横方向の発散力は電子の半径方向 座標に比例する,つまり,線形な空間電荷力であり,これ によるエミッタンス増大は生じない.ところが,電子バン チが時間方向に非一様な分布を持つ場合には,バンチの前 後で横方向の発散力が異なるためにバンチ全体ではエミッ タンス増大が生じる.これが横方向空間電荷力によるエ ミッタンス増大である.

図4は, ERL 入射部の電子銃直後における横方向空間電 荷力によるエミッタンス増大とその補償について示したも のである. (A)→(B)は, 横方向空間電荷力によるエミッタン ス増大に対応している. 個々のバンチスライス (バンチを 時間軸に垂直にスライスした部分) がスライスに含まれる 電子密度に応じて, (x-x') 平面で回転運動(発散)を行う 結果,投影エミッタンス(バンチ全体をx-x'平面に投影し たエミッタンス; projected emittance)が増大する. 放射 光源の輝度は投影エミッタンスで決まるため,投影エミッ タンスが増大するのは好ましくない. 断面方向の電子分布 が一様な場合,つまり,スライスエミッタンスが保存して いる条件下では,増大した投影エミッタンスを復元する (小さくする)ことができる. これをエミッタンス補償とよ ぶ.

図4(C)→(D)は,エミッタンス補償の様子を示したもので ある.空間電荷により発散した電子バンチをソレノイド磁 石で収束すると,発散の大きさに比例した収束力を受け る.ソレノイド下流で電子が再び発散を行うと,ある瞬間 にバンチスライスの向きが一致し,エミッタンスが回復す る.これがソレノイド磁石によるエミッタンス補償であ る.電子バンチがさらに下流に進むにつれて再びエミッタ ンスが増大するので,実際の設計では,電子が加速され空 間電荷が無視できるようになる位置で,エミッタンスが回 復するようにソレノイドの強さを決める.ソレノイド磁石 によるエミッタンス補償は,多くの理論解析で詳しく研究 されており実験的な検証も行われている[4].

5.2.2 縦方向の空間電荷力

電子が偏向磁石を含む軌道を通過するような場合,エネ ルギー広がりを持った電子ビームに対してもエミッタンス 増大が生じないよう,偏向磁石や四極磁石(収束磁石)を 組み合わせてアクロマティック(色消し)の条件を満たす ように軌道の設計を行う.アクロマティック軌道とは,同 一の軌道で入射したエネルギー(進行方向運動量)の異な



図4 光陰極電子銃を用いた ERL 入射器における,横方向空間電 荷力によるエミッタンス増大とソレノイド磁石によるエ ミッタンス補償の原理.(A)電子銃直後,(B)電子銃下流=エ ミッタンス増大,(C)ソレノイド直後,(D)ソレノイド下流= エミッタンス補償.

る電子が,出射後にも同一の軌道を取るような設計である.図5のERL 合流部では,3つの偏向磁石でアクロマティックの条件を作っている.

縦方向の空間電荷力は電子の加速に従って, γ⁻²で小さ くなる. ERL 光源の周回部 (5 GeV) では, この力は無視で きるほどに小さいが, ERL 合流部 (10 MeV) では空間電荷 力は無視できない. このため, 合流部ではアクロマティッ クの条件を与えたとしても,縦方向の空間電荷力によって 有意なエミッタンス増大が生じる場合がある.

縦方向の空間電荷力は,電子バンチの前方に位置する電 子のエネルギーを高くし,後方の電子のエネルギーを低く する効果を持つ.つまり,空間電荷力による電子バンチ内 部でのエネルギーの再配分が行われる.ERL 合流部におい て,このようなエネルギーの再配分が起こると,電子は設 計されたアクロマティック軌道から外れた運動を行う.こ の結果,合流部出口での電子ビームのエミッタンスが増大 する.これが,縦方向空間電荷力によるエミッタンス増大 である.

このようなエミッタンス増大を完全に打ち消すことはで きないが,エンベロープマッチングとよばれる手法を用い ることで,ある程度小さくすることは可能である[5].図6 に示すように,電子バンチを縦方向の座標位置でスライス し,ERL 合流部におけるそれぞれのスライスの運動を考え る.縦方向空間電荷力がある場合,バンチ内電子のエネル ギーの再配分によって各スライスが異なる軌道を取り合流 部出口で変位を生じる.これがエミッタンスの増大にな る.一方で,各スライスのエミッタンスは増大せずに初期



図5 3台の偏向磁石で構成される ERL の合流部. アクロマ ティックの条件を満たしているので,入射電子にエネル ギーの偏差があっても,出射後は同一の軌道になる.



図6 縦方向空間電荷力によるエミッタンス増大とその補償の原理.(A)合流部手前,(B)合流部下流=エミッタンス増大,(C) 合流部下流=エンベロープマッチングによるエミッタンス 補償を行った場合.合流部の内部で生じる電子バンチのエ ネルギー再配分により,バンチスライス毎に合流部出口で の軌道の不一致が生じる.これによりエミッタンスが増大 する.この軌道の不一致を電子ビームのエンベロープと調 和させることでエミッタンスの増大を最小にすることがで きる.この手法をエンベロープマッチングと言う. の値を保存している.そこで,合流部出口でバンチスライ スが変位する方向と,電子ビームののエンベロープを一致 させれば,スライスの変位による影響を最小にできる.こ れがエンベロープマッチングである.図6に示すように, 電子の偏向面における位置と運動量の位相空間における電 子の分布を考える.電子分布が作る楕円の主軸が,空間電 荷によるバンチスライスの変位の向きと一致する時,エン ベロープマッチングの条件が満たされ,エミッタンス増大 は最小になる.

5.3 空洞高次モードによるビームブレークアップ

ERL の加速空洞では,加速ビームと減速ビームが作る電 場が互いに打ち消し合うので,RF入力を一定としたまま 加速電流を大きく増やすことができる.しかしながら,現 実のERLでは,様々な要因によって加速できる電流に上限 がある.ビーム物理の観点から加速電流の制限となる最も 大きな要因は,空洞高次モード (Higher-Order Mode; HOM) によるビームブレークアップ (Beam Break-Up; BBU)である[6].

高周波加速空洞では,加速に寄与する固有モード(基本 モード)以外に、様々な固有モード(高次モード)が存在 する. これらの固有モードは、外部の RF 源と内部の電子 ビームの両方により励起される. 高次モードの中でも横方 向の電場成分を持つモード (dipole mode) は、中心軌道か ら外れて入射した電子バンチによって励起され、後続の電 子バンチに横方向のキックを与える. キックを与えられ基 準軌道から外れた電子バンチが, ERL 周回軌道を経た 後、キックを与えた高次モードを強める位置と位相で戻っ てくると、高次モードはさらに強められる.これが繰り返 されることで高次モードが指数的に成長し、電子バンチに 与える変位が周回軌道のビームパイプ径を越えるとビーム が失われ、エネルギー回収が動作しなくなり、ERL が停止 する(図7).この一連の現象が、高次モードによるビーム ブレークアップ (HOM-BBU) である. BBU が現れる電流 をBBUの閾値電流と呼ぶ.

HOM-BBUの閾値電流を大きくする(加速できる電流を 大きくする)ためには、(1)電子ビームと空洞 HOM のカッ



図7 HOM-BBUの原理:先行するバンチが励起した高次モード (HOM)によって後続のバンチが横方向へキックされる. キックされたバンチが周回後にHOMを強める位置と位相 で戻ってくると、HOMが指数的に成長し、ビームが失われ る.図は単一空洞に簡略化しているが、実際のERLでは多 数の空洞が存在する. プリングが小さくなる(HOM のインピーダンスを小さく なる)ように,空洞の形状を最適化する.(2)HOM の減衰が 早くなる(HOMのQ値が小さくなる)ように空洞の形状を 選び,適切な HOM 減衰機構(取り出しカップラーや吸収 材)を配置する.(3)HOM により横方向にキックされた電 子が周回後に空洞の中心から大きく外れないように周回軌 道を設計する,などの対策を組み合わせる必要がある.ま た,空洞の製作時に生じる空洞毎の HOM 周波数のばらつ きも,閾値電流の増大に寄与することが知られている.

HOM-BBUの解析には、多数の電子バンチをトラッキン グしながら HOM 振幅の時間発展を計算する方法(トラッ キング法)と、固有値問題として取り扱い不安定解を求め る方法(固有値法)がある.ここでは、トラッキング法に よる HOM-BBUの解析を示す.図8は、HOM-BBUの計算 例である.BBU 閾値を上回る電流を加速した場合、HOM -BBU が生じて電子ビームが横方向に発散してしまうのが わかる.

KEK, JAEA, 東京大学の共同チームでは, HOM-BBU の対策を特別に施した超伝導空洞(ERL 空洞)を開発して いる.5 GeV ERL の構成において, ERL 空洞を用いた場合 には 600 mA を越える閾値電流が得られることが示されて おり, ERL 放射光の運転条件(100 mA)では BBU が発生 せず,安定な加速が行えると期待される[7].

5.4 まとめ

低エミッタンス電子ビームを大電流で連続的に加速でき る ERL は,高輝度(高コヒーレント)X線の発生が可能な 次世代X線放射光源として,国内ではKEK,JAEA,東京 大学などの共同チームが研究開発を進めており,2012年に 完成予定の小型のERL(コンパクトERL)において,次世 代放射光源で要求される低エミッタンス大電流電子ビーム の技術実証を行う予定である[7].

紙幅の都合で詳述できなかったが, ERL は X 線放射光源 の他にも,大出力自由電子レーザー(FEL),レーザーコン



図8 HOM-BBUの計算例:BBU閾値を越える電流を加速した場合,時間とともに電子ビームが横方向に発散する様子が示されている.

プトン散乱と組み合わせた高輝度γ線源,イオンビーム冷 却用電子加速器などにも利用可能であり,それぞれの利用 に向けた研究開発が国内外で進んでいる[8].低エミッタ ンスかつ大電流の電子ビームを加速できる ERL の特長を 最大限に生かすためには,本章で紹介したようなビーム物 理の諸問題を理解した上で,ハードウェアの設計と開発を 行わなければならない.プラズマ・核融合学会の諸氏にも 関心を持っていただければ幸いである.

参考文献

- [1] G.R. Neil et al., Phys. Rev. Lett. 84, 662 (2000).
- [2] R. Hajima et al., Nucl. Instrum. Meth. A507, 115 (2003).
- [3] Sol M. Gruner et al., Rev. Sci. Instrum. 73, 1402 (2002).
- [4] X. Qiu et al., Phys. Rev. Lett. 76, 3723 (1996).
- [5] V.N. Litvinenko, R. Hajima and D. KayranNucl. Instr. Meth. A557, 165 (2006).
- [6] E. Pozdeyev et al., Nucl. Instrum. Meth. A557, 176 (2006).
- [7] 羽島良一 他:加速器 6,149 (2009).
- [8] Proc. the 41st ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Energy-Recovery Linac 2007, http://accelconf.web.cern.ch /accelconf/erl07/INDEX.HTM